



(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 355 337
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89112082.6

(51) Int. Cl.4: C01B 33/033

(22) Anmeldetag: 01.07.89

(30) Priorität: 15.07.88 DE 3824065

(71) Anmelder: BAYER AG

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.02.90 Patentblatt 90/09

D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(72) Erfinder: Kurz, Günter, Dr.

Niederrheinstrasse 288

D-4000 Düsseldorf 31(DE)

Erfinder: Abels, Martin

Stettiner Strasse 84

D-4150 Krefeld(DE)

Erfinder: Schwirtlich, Ingo, Dr.

Hausweberstrasse 26

D-4150 Krefeld 1(DE)

Erfinder: Woditsch, Peter, Dr.

Deswatinessstrasse 83

D-4150 Krefeld(DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von Solarsilicium.

(57) Verfahren zur Herstellung von Silicium durch Umsetzung von gasförmigen Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel SiH_nX_{4-n}, wobei X Halogen bedeutet und n Werte von 0 bis 3 annehmen kann, mit Aluminium, wobei bei der Umsetzung eine fein-verteilte schmelzflüssige Oberfläche, bestehend aus reinem Aluminium oder einer Al-Si-Legierung, mit der gasförmigen Siliciumverbindung intensiv kontaktiert wird.

EP 0 355 337 A1

Verfahren zur Herstellung von Solarsilicium

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Silicium durch Umsetzung von gasförmigen Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel $\text{SiH}_n\text{X}_{4-n}$, wobei X Halogen bedeutet und n Werte von 0 bis 3 annehmen kann, mit Aluminium.

Um durch photovoltaische Stromerzeugung Sonnenenergie großtechnisch im terrestrischen Bereich zu nutzen, kommt aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen z.Z. als Halbleitermaterial nur Silicium in Frage. Bis heute wird fast ausschließlich Silicium eingesetzt, dessen Ursprung im Halbleitersilicium zu sehen ist und dessen Herstellungsverfahren aus dem Bereich der Halbleitertechnologie bekannt sind.

Während die Materialkosten in der Halbleiterindustrie von untergeordneter Bedeutung sind, kommt ihnen bei der Photovoltaik eine ausschlaggebende Bedeutung zu, da die elektrische Leistung einer Solarzelle der Solarzellenfläche und damit der Materialmenge proportional ist.

Zur Lösung terrestrischer Energieprobleme kann die Photovoltaik dann beitragen, wenn es gelingt, Solarzellen zu entwickeln, die hinsichtlich Preis und Wirkungsgrad kostenmäßig mit den konventionellen Energiequellen konkurrieren können. Eine Grundbedingung zur Nutzung der Sonnenenergie im großen Maßstab ist daher ein wirtschaftliches Verfahren zur Siliciumherstellung, das den Anforderungen an Solarsilicium genügt.

Zur Herstellung von Solarsilicium wurden verschiedene Verfahren vorgeschlagen:

Die Reduktion hochreinen Quarzsandes mit hochreinem Kohlenstoff in der DE-A 3 013 319, die Reinigung von metallurgischem Silicium (DE-A 2 623 413)

die Reduktion von SiO_2 mit Aluminium (EP-A 0 029 182)

die Reduktion von SiF_4 oder SiCl_4 mit Natrium (Mater. Res. Bull. 16(4), 437 (1981); DE-A 2 800 254),

die Reduktion von SiCl_4 mit Zink (US-A 3 012 862) sowie

die Reduktion von SiCl_4 mit Aluminium bei 360°C (P. Pascal, Nouveau traité de chimie minérale, Band VIII, 2. Heft, Silicium, Seite 275).

Aus wirtschaftlicher Sicht genügen diese Verfahren nicht den Ansprüchen, um im großtechnischen Maßstab ein Silicium für Solarzellen herzustellen. Aus der EP-A-0 123 100 ist ein Verfahren bekannt, bei dem festes Aluminium mit Si-Halogeniden bei 500 bis 660°C umgesetzt wird. Mit diesem Verfahren wird ein reines für Solarzellen geeignetes Silicium in wirtschaftlicher Weise erhalten.

Von Yoshizawa et al. (Kagyo kagaku Zasshi 64

(1961), 1347 bis 1350) wird die Reaktion von flüssigem Aluminium mit SiCl_4 zwischen 750 und 1000°C beschrieben. Dabei wird ein Bad aus flüssigem Aluminium bei Reaktionstemperatur vorgelegt und Siliciumtetrachlorid übergeleitet. Danach werden maximal 50 Gew.-% Silicium mit anhaftendem Aluminium gewonnen. Das Silicium wurde durch Lösen des Restaluminiums in Säure isoliert. Diese Methode ist für ein wirtschaftliches Verfahren nicht praktikabel. Da für die von Yoshizawa et al. angegebene Reaktionsführung die Diffusion von gelöstem Silicium im geschmolzenen Aluminium ($D = 10^{-5} \text{ cm}^2 / \text{S}$) der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist, ergeben sich relativ lange Reaktionszeiten. Ein kompletter Aluminiumumsatz in wirtschaftlich vertretbarer Zeit findet nicht statt.

Die Reaktion wird dabei im wesentlichen von der Temperatur, der Atmosphäre sowie dem SiCl_4 -Durchsatz beherrscht. Auch bei den beschriebenen Optimierungen blieben die oben beschriebenen Nachteile bestehen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein wirtschaftliches Verfahren zur Verfügung zu stellen, welches die oben beschriebenen Nachteile nicht aufweist.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß bei einer entsprechenden Verfahrensführung, bei der ein intensiver Kontakt einer möglichst großen Aluminiumoberfläche mit dem Reaktionsgas sichergestellt ist, die nahezu quantitative Umsetzung in wirtschaftlicher Weise möglich ist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung von Silicium durch Umsetzung von gasförmigen Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel $\text{SiH}_n\text{X}_{4-n}$, wobei X Halogen bedeutet und n Werte von 0 bis 3 annehmen kann, mit Aluminium, wobei bei der Umsetzung eine feinverteilte schmelzflüssige Oberfläche, bestehend aus reinem Aluminium oder einer Al-Si-Legierung, mit der gasförmigen Siliciumverbindung intensiv kontaktiert wird. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßigen Verfahrens wird die intensive Kontaktierung durch eine feine Verteilung des schmelzflüssigen Aluminiums in einem Raum erreicht, der die gasförmige Siliciumverbindung enthält. Besonders gute Ergebnisse werden dann erreicht, wenn die schmelzflüssige Oberfläche mindestens $10^{-3} \text{ m}^2/\text{g}$ beträgt. Umgekehrt ist natürlich auch die feine Verteilung von SiCl_4 -Gas in flüssigem Aluminium möglich. Um einen quantitativen Umsatz zu erhalten, muß eine intensive Kontaktierung durch eine feine Verteilung der gasförmigen Siliciumverbindung in der Schmelze erreicht werden. Dies kann erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, daß das Maximum der

Gasblasenverteilung in der Schmelze bei einer Gasblasengröße von maximal 5 mm eingestellt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Aluminium in Form feiner Tröpfchen besonders bevorzugt Aluminiumtröpfchen <500 µm zur Reaktion gebracht. Bei der Reaktion von Aluminiumtröpfchen erhält man als Produkt einen Silicium-Grieß mit vergleichbarer Korngröße, der sich gut handhaben lässt. Die Überführung des flüssigen Aluminiums in Tröpfchenform erfolgt nach bekannten Verfahren (A. Lowley International Journal of Powder Metallurgy and Powder Technology Vol. 13 (3) Juli 1977), z.B. der Verdüstung einer Schmelze mit Ein- oder Zwei-stoffdüsen bzw. der Zerteilung der Schmelze durch Zentrifugalkräfte. Entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der Zerteilungsprozeß direkt in einer Silicium-Halogenid-Atmosphäre durchgeführt, wobei die Reaktion stattfindet. Der anzustrebende quantitative Umsatz ist dabei abhängig von der Aluminiumschmelzteilchengröße, der Verweilzeit und der Silicium-Halogenid-Gaskonzentration. Die bevorzugte Temperatur beim erfindungsgemäßen Verfahren liegt oberhalb von 660 °C, besonders bevorzugt zwischen 700 °C und 1000 °C.

Die Verweilzeit kann über die Flug- bzw. Fallstrecke der Schmelzteilchen im Reaktor eingestellt werden. Die Schmelzteilchengröße hängt von den Parametern des Zerteilungsprozesses ab. Bei der Verdüstungsmethode kann sie über Vordruck und Düsenwahl eingestellt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist unabhängig von der Verwendung eines bestimmten Siliciumhalogenids, Halogensilans, Silans oder irgendeiner zwei- oder mehr-komponentigen Mischung derselben sowie unabhängig von ihrer Gewinnung aus irgendeinem chemischen oder physikalischen Prozeß. Dabei werden als Halogenide im Sinne der Erfindung Fluor, Chlor, Brom und Iod verstanden. Die Zufuhr der gasförmigen Siliciumverbindung zur Reaktion kann in reiner Atmosphäre oder zusammen mit inerten, an der Reaktion nicht teilnehmenden Gasen, wie z.B. Ar, SF₆ erfolgen. Vorzugsweise wird die Siliciumverbindung im Überschuß eingesetzt.

In einer besonders bevorzugten Erfindungsform wird als Siliciumverbindung Siliciumtetrachlorid SiCl₄ eingesetzt. Bei der Umsetzung von destillativ gereinigtem SiCl₄ mit reinem Aluminium bildet sich reines Silicium neben reinem AlCl₃. Diese Variante kann zu einem eleganten Kreisprozeß (EP-A 0 123 100) des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgestaltet werden. Dabei ist der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber EP-A 0 123 100 darin zu sehen, daß durch Rein-AlCl₃-Elektrolyse erhaltenes hochreines Aluminium direkt flüssig in den Prozeß zurückgeführt werden kann. Durch Einsparung eines Verfahrensschrittes, nämlich der Über-

führung des Aluminiums in eine feinteilige feste Form, ist ein hoher wirtschaftlicher und Qualitätsvorteil bezüglich Produktreinheit gegeben. Die Produktionskapazität gegenüber der EP-A 0 123 100 wird beträchtlich gesteigert.

Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft erläutert, ohne daß hierin eine Einschränkung zu sehen ist.

Beispiel 1

In einer auf 800 °C beheizten Apparatur, bestehend aus einem 100-l-Quarzglasgefäß mit Gasein- und -auslaßstutzen, wird über eine darin eingelassene Verdüstungsvorrichtung (Düsendurchmesser 1 mm) bei einem Vordruck von 4 bar innerhalb von 10 s ca. 0,3 kg schmelzflüssiges Aluminium in eine SiCl₄-Atmosphäre verdüst. Die Zufuhr an, auf 600 °C geheiztem und gereinigtem SiCl₄, wird dabei so eingestellt, daß ein stöchiometrischer SiCl₄-Überschuß von 200 % gewährleistet ist. Das eingesetzte Aluminium setzt sich nahezu vollständig unter Bildung von AlCl₃ zu Silicium um. Das absublimierte AlCl₃ wird mit dem überschüssigen SiCl₄ abgeleitet und in geeigneten Vorlagen kondensiert. Am Austrag des Reaktors wird das gebildete Silicium in Form von Granulat (Korndurchmesser zwischen 100 und 800 µm) abgenommen. Die Verunreinigungen im Silicium sind von den Verunreinigungen im eingesetzten Aluminium abhängig. Bei Verwendung von reinstem Aluminium wird direkt ein hochreines Silicium erhalten.

Beispiel 2

In einem Quarzgefäß werden 100 g geschmolzenes Aluminium bei 700 °C vorgelegt. Das Gefäß ist mit einem Einleitrohr aus Quarzglas versehen. Durch dieses werden innerhalb von 1 Std. insgesamt 1200 g SiCl₄ in die Schmelze eingeleitet, wobei die Temperatur kontinuierlich auf 1460 °C gesteigert wird. Die Abgase werden dabei über einen Stutzen in eine Kondensationsapparatur abgeführt. Nach dem Erkalten werden 40 g hochreines Silicium in Form eines Regulus gewonnen.

Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Silicium durch Umsetzung von gasförmigen Siliciumverbindungen der allgemeinen Formel SiH_nX_{4-n}, wobei X Halogen bedeutet und n Werte von 0 bis 3 annehmen kann, mit Aluminium, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Umsetzung eine feinverteilte schmelzflüssige Oberfläche, bestehend aus reinem Aluminium oder

einer Al-Si-Legierung, mit der gasförmigen Siliciumverbindung intensiv kontaktiert wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die intensive Kontaktierung durch eine feine Verteilung des schmelzflüssigen Aluminiums in einem Raum erreicht wird, der die gasförmige Siliciumverbindung enthält. 5
3. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die schmelzflüssige Oberfläche mindestens $10^{-3} \text{ m}^2 / \text{g}$ Aluminium beträgt. 10
4. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die intensive Kontaktierung durch eine feine Verteilung der gasförmigen Siliciumverbindung in der Schmelze erreicht wird. 15
5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Maximum der Gasblasenverteilung in der Schmelze bei einer Gasblasengröße von maximal 5 mm eingestellt wird. 20
6. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Aluminium in Form feiner Tröpfchen zur Reaktion gebracht wird. 25
7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß bevorzugt Al-Tröpfchen <500 μm zur Reaktion gebracht werden. 30
8. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktion bei Temperaturen oberhalb von 660 °C, bevorzugt zwischen 700 °C und 1000 °C, durchgeführt wird. 35
9. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das schmelzflüssige Aluminium durch Verdüsen in Tröpfchenform überführt wird. 40
10. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Tröpfchenform des schmelzflüssigen Aluminiums durch Zentrifugalkräfte erhalten wird. 45



| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|--|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betritt Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| A | CHEMICAL ABSTRACTS, Band 57, Nr. 3, Seite 1962, Zusammenfassung Nr. 3076i-3077a; S. YOSHIZAWA et al.: "Reduction of silicon tetrachloride with aluminum" & KOGYO KAGAKU ZASSHI 64, 1347-50(1961); & Kat. D,A --- | | C 01 B 33/033 |
| A | DE-C- 874 137 (J.H. GERDEMANN) --- | | |
| D,A | EP-A-0 123 100 (BAYER AG) --- | | |
| A | SEVENTH E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. Proceedings of the international conference, held at Sevilla, Spain, 27.-31. Oktober 1986, D. Reidel Publ. Co., Dordrecht, NL; I.A. SCHWIRTLICH et al.: "Solar-grade Silicon<" ----- | | RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl.5) |
| | | | C 01 B 33/00 |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | Abschlußdatum der Recherche 20-10-1989 | Prüfer BREBION J.CH. | |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | | |